利用银纳米立方增强效率的多层溶液 加工白光有机发光二极管^{*}

张雅男1) 詹楠2) 邓玲玲2) 陈淑芬3)†

(南京信息工程大学物理与光电工程学院,南京 210044)
 2)(南京邮电大学电子与光学工程学院、微电子学院,南京 210023)
 3)(南京邮电大学材料科学与工程学院,有机电子与信息显示重点实验室,南京 210023)

(2019年10月9日收到; 2019年12月16日收到修改稿)

金属纳米粒子的局域表面等离子体共振效应常被用于增强有机发光二极管中激子辐射强度,其增强效 果与金属纳米粒子的共振波长、共振强度及其与激子之间的耦合密切相关.本文将具有较强局域表面等离子 体共振效应的银纳米立方引入多层溶液加工白光有机发光二极管中提升器件性能.在传统的溶液加工有机 发光二极管中,发光层主体一般具有较强的空穴传输性,因此激子主要在发光层/电子传输层界面附近复合. 本文将银纳米立方掺入电子传输层中,使银纳米立方与激子之间产生充分的耦合作用,提高激子发光强度. 对银纳米立方包裹二氧化硅外壳,一方面优化纳米立方与激子之间的距离,另一方面减小其对器件中电荷传 输的影响.通过优化银纳米立方的浓度,多层溶液加工白光有机发光二极管的电流效率达到 30.0 cd/A,是基 础器件效率的 2 倍.另外,由于银纳米立方的等离子体共振光谱较宽,同时增强了白光中蓝光和黄光的强度, 因此引入银纳米立方基本没有影响白光的色度.研究结果表明引入金属纳米粒子是提升多层溶液加工发光 二极管性能的有效方法.

关键词: 白光有机发光二极管, 银纳米立方, 局域表面等离子体共振, 溶液加工电子传输层 PACS: 78.20.Bh, 78.40.Kc, 78.67.Bf DOI: 10.7498/aps.69.20191526

1 引 言

白光有机发光二极管 (white organic lightemitting diode, WOLED)由于其简单的制备方法 和丰富的材料体系而吸引了广泛的关注,在平板显 示和固态照明领域有很大的应用前景^[1,2].高性能 的WOLED 一般通过逐层热蒸镀各个有机功能层 的方法制备得到.但是,成本高、产率低、难以实现 大面积制备等缺点也制约着热蒸镀方法在 WOLED 产业化进程中的使用^[3].具有工艺简单、成本低和可大面积制备的溶液加工技术更适用于 WOLED 的量产.

对于溶液加工型的多层 WOLED, 溶液制备 电子传输层的过程, 必然部分溶解下方的发光层, 使器件的发光性能降低. 因此在溶液加工的过程中 保持住发光层的发光性能是制备高性能器件的关 键^[4,5]. 为了保护发光层不受溶液制备电子传输层

© 2020 中国物理学会 Chinese Physical Society

^{*} 国家重点基础研究发展计划(批准号: 2015CB932203)、国家重点研发计划(批准号: 2017YFB0404501),国家重大基础研究项目 (批准号: 91833306)、国家自然科学基金(批准号: 61505086, 61575096, 61705111)、江苏省杰出青年科学基金(批准号: BK20160039)、江苏省自然科学基金(批准号: BM2012010)、江苏省高等学校重点学科建设项目(批准号: YX030002)和博士后 创新人才支持计划(批准号: BX201700122)资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: iamsfchen@njupt.edu.cn

的破坏,一方面通常采用甲醇、乙醇或者乙醇/水 等正交溶剂,结合溶解性好、电子传输性能强的有 机电子传输材料,如TPBi (1,3,5-Tris(1-phenyl-1Hbenzimidazol-2-yl)benzene)制备电子传输层^[6–8]. 另一方面,则采用聚合物主体材料,如PVK (polyvinylcarbazole),制备发光层,因为这类聚合 物在退火过程中形成的分子链之间的缠结可以抵 挡电子传输层溶剂的清洗,从而保持发光层的发光 性能^[9,10]. 但是,PVK 作为主体材料也有一些不足 之处,比如,三线态能级 ($E_T = 2.5 \text{ eV}$)较低,无法 向蓝光激子提供有效的能量转移;空穴传输性较 强,导致激子在界面聚集引起激子淬灭^[11].

金属纳米粒子在受到外部电磁场激发的条件 下,其表面的自由电荷与电磁场之间能产生耦合作 用. 当电磁波的波长满足自由电荷形成集体振荡的 条件时,将发生共振吸收,使金属纳米粒子表面的 电场显著增强,这种现象称为局域表面等离子体共 振 (localized surface plasmon resonance, LSPR) 效应^[12,13]. LSPR效应可以增强金属纳米粒子周围 电场强度,从而改变附近激子的辐射或电荷的传 输,因此被广泛地应用于各类有机、无机及钙钛矿 发光二极管中提升器件性能 [14-17]. 在有机发光二 极管中,比较常用的空穴注入层 PEDOT:PSS (poly (styrene sulfonic acid)-doped poly (3, 4ethylenedioxythiophene)通常采用溶液加工的方法 制备,既易与液相法制备的金属纳米粒子结合,又 与发光层相邻,因此金属纳米粒子常被引入空穴注 入层 (hole injection laver, HIL) 中改善器件性能 ^[18]. 然而, 对于基于 PVK 主体的溶液加工型的有 机发光二极管, PVK 的单极空穴传输特性使激子 主要在发光层 (emission layer, EML)/电子传输 层 (electron transporting layer, ETL) 界面附近形 成并复合,距离空穴注入层较远.因此掺入 HTL 的金属纳米粒子与激子之间的相互作用比较 弱,对器件性能的改善效果并不好.

本文将二氧化硅包裹的银纳米立方 (Ag@SiO₂ NCs) 掺入基于 PVK 主体的多层溶液加工 WOLED 的 ETL 中. 银纳米立方由于具有比较尖锐的形状, 所以有很强的 LSPR 效应, 能够增强附近激子的辐射强度, 从而提升有机发光二极管的性能^[19].将 Ag@SiO₂ NCs 掺入 ETL, 使其与位于 EML/ETL 界面附近的激子之间的距离较近, 能够更加有效地

增强激子的辐射. 通过对 ETL 中 Ag@SiO₂ NCs 浓度的优化, 多层溶液加工 WOLED 的最大亮度 达到 19427 cd/m², 最高电流效率达到 30.0 cd/A, 是未加入 Ag@SiO₂ NCs 的基础器件效率的 2 倍.

2 实 验

首先, ITO 玻璃基片 (ITO/Glass) 用丙酮、乙 醇和去离子水进行超声清洗,并在真空烘箱中 120 °C 烘干 1 h. 接着, 用紫外光对 ITO 进行处理 后,在ITO上旋涂45nm的PEDOT:PSS,并 120°C 退火 30 min 制备得到空穴注入层. 然后, 将发光主体和客体材料按照一定的重量比 PVK: OXD-7 (重量比 5:2): 10wt% FIrpic: 0.5wt% PO-01 混合后溶解于氯苯, 旋涂在 PEDOT:PSS层上, 并且 90 °C 退火 30 min 后获得 70 nm 发光层. 在 发光层中, OXD-7 (2, 2'-(1, 3-Phenylene) bis[5-(4-(tert-butylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole]), 是一种 电子传输型且三线态能级较高的主体材料,与 PVK 混合后可以平衡发光层中的电荷传输, 拓宽 激子的复合区域,减少激子淬灭. FIrpic ([bis(4, 6difuorophenyl)-pyridinato-N,C²]picolinate) 和PO-01 ([3, 2-c]pyridinato-N, C2') acetylacetonate) 分别是蓝光和黄光客体,混合后实现白光发射.制 备完发光层后,将 TPBi和 TmPyPB (1, 3, 5tri(m-pyrid- 3-yl-phenyl)benzene) 按照 7:3 的重 量比溶解于乙醇/水(体积比9:1)混合溶剂中,旋 涂在发光层上并 120°C 退火 30 min 得到 45 nm 的溶液处理电子传输层 (solution-deposited ETL). 在 ETL 的溶液制备过程中,发光层被其中的溶剂 少量溶解,最终的发光层厚度为50 nm 左右.对于 银纳米立方的使用,我们采用实验室自制的 Ag@SiO2 NCs(制备方法参考文献 [20]), 将之分散 在乙醇中,并以一定的体积比与电子传输层溶液或 者空穴注入层溶液 PEDOT:PSS 混合, 然后旋涂 制备掺有银纳米立方的电子传输层和空穴注入层. 最后,旋涂了全部有机功能层的基片被转入真空热 蒸镀设备中, 蒸镀 LiF (1 nm)/Al (100 nm) 作为 阴极.最终基于银纳米立方的多层溶液加工 WOLED的器件结构为 ITO/PEDOT:PSS (45 nm)/EML(50 nm)/ETLAg@SiO₂NCs(45 nm)/ LiF (1 nm)/Al (100 nm), 如图 1 所示.



图 1 电子传输层中掺有 Ag@SiO₂ NCs 的 WOLED 器件 结构示意图

Fig. 1. Schematic structure of the WOLED with Ag@SiO_2 NCs doped in ETL.

3 实验结果与讨论

图 2(a) 和 2(b) 给出了银纳米立方包裹前后的 透射电子显微镜 (transmission electron microscope, TEM) 图像. 从图中可以看出, 银纳米立方的平均 边长为 40 nm, 而 SiO₂ 壳层均匀地包裹着银纳米 立方, 厚度约 17 nm. 图 2(c) 给出电子传输层在

400—650 nm 波长范围内的吸收光谱, 可以看到掺 入 $Ag@SiO_2$ NCs 后, 电子传输层的吸收明显提高 了. 在波长 450 nm 处出现一个吸收峰, 与银纳米 立方的吸收峰相对应.同时,Ag@SiO2 NCs引起 的吸收增强的范围基本覆盖了蓝光和黄光的光致 发光 (photoluminescence, PL) 光谱, 表明蓝光和 黄光激子的发光可以激发 Ag@SiO2 NCs 的等离 子体共振电场,并进而增强激子的发光强度.根据 TEM 图,我们了解到所采用的 Ag@SiO₂ NCs 的 尺寸大于器件中电子传输层的厚度,为了观察纳米 粒子对电子传输层形貌的影响,我们拍摄了掺有纳 米粒子的电子传输层的扫描电子显微镜 (scanning electron microscope, SEM) 图像, 如图 2(d) 所示. 由于银纳米立方的掺杂浓度很低,其在电子传输层 中的分布十分稀疏,我们将掺杂浓度提高为 10% 后,观察到图 2(d) 所示的银纳米立方分布.从 图中可以看到,部分尺寸较大的 Ag@SiO2 NCs 未 被电子传输层完全覆盖而露出膜层. 但是纳米粒子 的数量较少,且未发生团聚,因此对电子传输层形 貌虽有一定影响,但影响较小.



图 2 (a) 银纳米立方和 (b) Ag@SiO₂ NCs 的 TEM 图像; (c) TPBi 和掺有 Ag@SiO₂ NCs 的 TPBi 的吸收光谱, 以及 FIrpic 和 PO-01 的 PL 光谱; (d) 掺有 Ag@SiO₂ NCs 的 TPBi 表面的 SEM 图像

Fig. 2. TEM images of (a) Ag NCs and (b) Ag@SiO₂ NCs; (c) Absorption spectra of TPBi and TPBi:Ag@SiO₂ NCs, and PL spectra of FIrpic and PO-01; (d) SEM image of the surface of ETL doped with Ag@SiO₂ NCs.

图 3(a) 给出一组 WOLED 的亮度-电压关系 曲线,其中ETL 中掺有 Ag@SiO2 NCs 的器件,掺杂 浓度分别为1%, 1.5% 和2%, 而未掺杂 Ag@SiO2 NCs 的器件为基础器件.由于采用溶液加工方式,器件 结构比较简单,器件中电子和空穴的注入势垒比较 高,所以器件整体启亮电压偏高,普遍在5-6V 之间. 但是从图中可以看到, 掺有 Ag@SiO2 NCs 的 WOLED, 亮度明显高于基础器件. 当 Ag@SiO2 NCs 掺杂浓度为 1.5% 时, 器件的亮度达到最大值 19427 cd/m². 从图 3(b) 的电流密度-电压关系图 可以看出, Ag@SiO2 NCs 的掺入使器件电流略有 增大,但远小于其对器件亮度的提升.由于 Ag@SiO2 NCs的掺入大幅提升了器件亮度而对器 件电流影响较小,因此掺入 Ag@SiO₂ NCs 后的 WOLED 的器件效率明显提高. 当 Ag@SiO₂ NCs 掺杂浓度为 1.5% 时, WOLED 的电流密度达到 30.0 cd/A, 为基础器件的 2 倍, 表现出十分明显的 效果. 图 3(d) 给出了这组器件的归一化电致发光

(electroluminescence, EL) 光谱, 可以看到银纳米 立方的掺入基本没有影响器件光谱. 插图为银纳米 立方浓度 1.5% 的优化器件在不同电压下的归一 化 EL 光谱, 光谱基本不随电压变化, 可见掺入 Ag@SiO₂ NCs 后, WOLED 仍然表现出出色的色 度稳定性.

为了研究 Ag@SiO₂ NCs 提升器件性能的工作机理, 我们从光学和电学效应两方面作进一步的表征. 首先, 测量了一组样品的 PL 光谱. 样品结构为ITO/PEDOT:PSS (45 nm)/EML (50 nm)/ETL (45 nm): Ag@ SiO₂ NCs, 其中电子传输层中的Ag@SiO₂ NCs 的掺杂浓度分别为 1%, 1.5%和 2%, 另有一个未掺有 Ag@SiO₂ NCs 的样品作为对比. 图 4(a)为这组样品的 PL 光谱, 可以看出掺入银 Ag@SiO₂ NCs 后, 蓝光和黄光的峰位相对于未掺杂的对比样品均未发生偏移, 说明银纳米立方未改变激子的辐射机制. 同时, 我们看到掺入的银纳米立方的浓度明显影响着激子的辐射强度. 随着



图 3 掺有 1%, 1.5%, 2% Ag@SiO₂ NCs 的 WOLED 以及基础器件的光电性能 (a) 亮度-电压; (b) 电流密度-电压; (c) 电流效率-亮度; (d) 归一化光谱.图 (d) 中的插图为掺有 1.5% Ag@SiO₂ NCs 的 WOLED 在不同电压下的归一化光谱

Fig. 3. (a) Luminance-voltage, (b) current density-voltage, (c) efficiency-luminance properties and (d) normalized electroluminescent spectra of the WOLEDs with 1%, 1.5%, 2% Ag@SiO₂ NCs and the control device. The inset of Fig. (d) is the normalized electroluminescent spectra of the WOLED with 1.5% Ag@SiO₂ NCs at different luminance. 银纳米立方的掺入,且浓度从1%增加到1.5%, PL强度不断增强,但是当浓度继续增加到2%, PL强度则明显减弱,显然1%浓度的银纳米立方 不能产生足够的等离子体共振,而2%浓度的银纳 米立方产生的 LSPR 过强引起了激子淬灭. 因此对 于本文的 WOLED, 1.5% 的 Ag@SiO2 NCs 能够 实现最强的 LSPR 效应. 此外, 我们可以看到 Ag@SiO₂ NCs 同时增强了蓝光和黄光的强度, 这 一点与图 2(c) 中 Ag@SiO₂ NCs 的吸收谱同时覆 盖蓝光和黄光的 PL 光谱相对应, 说明 Ag@SiO2 NCs 掺入有机材料中之后, 在较宽的波长范围内 实现了 LSPR 共振增强. 从图 4(b) 的归一化 PL 光谱同样可以看到, 掺有 1% 和 1.5% Ag@SiO2 NCs 样品的 PL 光谱, 其蓝光和黄光的相对强度与未掺 Ag@SiO2 NCs的对比样品基本一致. 但是 2%浓 度的银纳米立方对蓝光激子的淬灭更严重,说明银



图 4 (a) 未归一化和 (b) 归一化的 PL 光谱. 样品结构为: ITO/PEDOT:PSS (45 nm)/EML (50 nm)/ETL (45 nm): Ag@SiO₂ NCs, 其中 Ag@SiO₂ NCs 浓度为 1%, 1.5% and 2%

Fig. 4. (a) PL spectra and (b) normalized PL spectra of the samples of ITO/PEDOT:PSS (45 nm)/EML (50 nm)/ETL (45 nm) doped with 1%, 1.5% and 2% Ag@SiO₂ NCs and the control sample without NCs.

纳米立方与蓝光激子之间的作用较强,因此在高浓 度下发生了淬灭.此外,纳米立方对 PL 光谱与 EL 光谱的影响基本相同,包括 2%浓度的银纳米 立方对发光激子的淬灭现象,证明了银纳米立方的 等离子体共振效应是导致 WOLED 性能变化的主 要因素.

图 3(b) 中, 银纳米立方使 WOLED 的电流密 度略有提升,为了研究这种提升是否与等离子体共 振效应有关,我们制备了一组单电子器件,并测试 其电流密度-电压关系. 单电子器件的结构为: ITO/TPBi:TmPyPB (45 nm)/PVK:OXD-7:15wt. % FIrpic:0.5% PO-01 (50 nm)/TPBi:TmPyPB (45 nm)/Al (100 nm), 将 1%, 1.5% 和 3%的 Ag@SiO2 NCs 掺入电子传输层中. 从图 5 中的电 流密度-电压关系曲线可以看出,纳米立方的掺入 同样使单电子器件的电流密度有所提升.由于单电 子器件中不存在等离子体共振效应,因此电流的提 升与等离子体共振效应无关,可能是由于纳米粒子 增加了电子传输层的表面粗糙度而引起少量的漏 电流[21,22]. 其中, 掺入 3% 高浓度的银纳米立方后, 单电子器件的电流显著提升,进一步验证了掺入银 纳米立方引起的表面粗糙度增加对器件中的电流 密度有重要的影响作用.



图 5 单电子器件的电流密度-电压关系 Fig. 5. Current density-voltage property of the electron-only

在基于空穴型主体材料 PVK 的 WOLED 中, 激子主要在发光层/电子传输层界面附近复合发 光,因此位于电子传输层中的银纳米粒子能够更好 地与激子发生等离子体共振耦合.为了进一步说明 这一工作机理,我们将 1.5% 的银纳米立方分别掺 入空穴注入层,电子传输层,以及同时掺入空穴注

devices.

入和电子传输层,并将三种不同的器件分别命名 为 H-WOLED, E-WOLED 和 H&E-WOLED. 除 了纳米立方的掺入位置有所调整,器件结构与前文 中的溶液加工型 WOLED 的结构相同. 图 6(a) 给 出了这组器件的电流密度随工作电压的变化关系, 从图中可以看出,银纳米立方被二氧化硅包裹后, 对器件电流密度的影响总体较小,其中掺入空穴注 入层的银纳米立方所引起的电流增大相对明显. 从 图 6(b) 的亮度-电压关系图可以看到, 掺入空穴注 入层和电子传输层的银纳米立方均能有效提高器 件的发光强度, 其中, 电子传输层中掺入银纳米立 方的 E-WOLED 在相同的电压下获得了最高亮度. 显然, 银纳米立方掺入电子传输层后, 一方面可以 更加有效地与激子发生耦合提高激子的辐射效率, 另一方面并不引起很大的漏电流, 因此对器件电流 效率的提升效果明显优于将银纳米立方掺入空穴



图 6 在 WOLED 中不同位置掺入 Ag@SiO₂ NCs 后的器件性能 (a) 电流密度-电压关系; (b) 亮度-电压关系; (c) 电流效率-亮 度关系

Fig. 6. (a) Current density-voltage, (b) luminance-voltage and (c) current efficiency-luminance properties of the WOLEDs with $Ag@SiO_2 NCs$ doped in different layers and the control device without $Ag@SiO_2 NCs$.

				_		
Table 1.	Summarv	of the	optoelectrical	performances	of the	WOLEDs.

WOLED	$\begin{array}{c} {\rm Max} \\ {\rm Luminance/cd} {\cdot} {\rm m}^{-2} \end{array}$	Max Current Efficiency/cd·A ⁻¹	Max Power Efficiency/lm·W ⁻¹	Current Efficiency Enhancement/%	Power Efficiency Enhancement/%
W/O NCs	10091	14.7/14.1 $^{\rm a}$	8.5/7.7 ^a		
$1\%~{\rm NCs}$ in ETL	15293	20.7	13.3	40.8 ^b	56.5 $^{ m b}$
$1.5\%~{\rm NCs}$ in ETL	19427	30.0/26.3 ^a	18.3/16.5 ^a	104.1/86.5 ^a	115.3/114.3 ^a
2% NCs in ETL	12091	16.9	11.1	15.0 $^{ m b}$	30.6 $^{ m b}$
$1.5\%~\mathrm{NCs}$ in HIL	16545	17.6	11.5	24.8 $^{\rm c}$	49.4 °
1.5% NCs in HIL&ETL	11879	19.2	17.7	36.9 °	129.9 °

^a 图3中的器件效率或效率增强幅度/图6中的器件效率或效率增强幅度;

^b 相对于图3中基础器件的效率增强幅度;

。相对于图6中基础器件的效率增强幅度.

注入层这种传统的掺入方式,如图 6(c)中的电流 效率-亮度曲线所示.另外,还可以看到尽管将银纳 米立方分别掺入空穴注入层和电子传输层都能提 高器件性能,但是同时在空穴注入层和电子传输层 中掺入银纳米立方的 H&E-WOLED 器件,其效率 并未得到进一步提升,且在高亮度下,表现出严重 的效率滚降.表1中列出了本文中所讨论的 WOLED 器件的性能.由于基础器件和银纳米立方浓度为 1.5% 的器件在图 3 和图 6 对应的实验中获得了两 组趋势一致、数值略有差异的数据,因此我们在表1 中分别列出两组实验中的数据.

4 结 论

本文制备了多层溶液加工的 WOLED, 并通 过在电子传输层中掺入二氧化硅包裹的银纳米立 方提升器件性能. 通过调整掺入纳米立方的浓度, WOLED 性能得到明显提升, 最优化器件的电流 效率是未掺纳米粒子的基础器件效率的2倍,达到 了 30.0 cd/A. 研究了银纳米立方影响 WOLED 器 件性能的工作机理,发现相比于掺入空穴注入层的 传统掺杂方式,掺入电子传输层中的银纳米立方能 够更加有效地与位于发光层/电子传输层界面附近 的激子之间发生耦合,利用等离子体共振效应增强 激子的发光强度.同时发现,银纳米立方具有较宽 的共振范围,能够同时增强蓝光和黄光的辐射,使 WOLED 的色度保持稳定. 研究结果表明金属纳 米粒子能够方便地与溶液加工型有机发光二极管 结合,并通过结构设计有效提升发光激子的辐射强 度,在低成本高性能的溶液加工型有机发光领域具 有潜在的应用价值.

参考文献

- [1] Kido J, Kimura M, Nagai K 1995 Science 267 1332
- [2] Sasabe H, Takamatsu J, Motoyama T, Watanabe S, Wagenblast G, Langer N, Molt O, Fuchs E, Lennartz C, Kido J 2010 Adv. Mater. 22 5003
- [3] Sun Y, Giebink N C, Kanno H, Ma B, Thompson M, Forrest S 2006 Nature 44090 8
- [4] Sax S, Mauthner G, Piok T, Pradhan S, Scherf U, List E J W 2007 Org. Electron. 8 791
- [5] Lee T, Noh T, Shin H, Kwon O, Park J, Choi B, Kim M, Shin D W, Kim Y 2009 Adv. Funct. Mater. 19 1625
- [6] You J, Tseng S, Meng H, Yen F, Lin I, Horng S 2009 Org. Electron. 10 1610
- [7] Kim K, Lee J, Park T, Jeon W, Kennedy G, Kwon J 2010 Synth. Met. 160 631
- [8] Zhao Q, Zhang W, Fan Z, Li J, Chen X, Luo G, Zhang X 2015 Synth. Met. 204 70
- [9] Ho S, Liu S, Chen Y, So F 2015 J. Photon. Energy 5 057611
- [10] Yook K, Lee J 2014 Adv. Mater. 26 4218
- [11] Noh Y, Lee C, Kim J, Yase K 2003 J. Chem. Phys. 118 2853
- [12] Kim D H, Kim T W 2016 Org. Electron. 34 262
- [13] Xu Y, Zhou H, Zhang R, Liu Y, Zhang Q, Zhang S, Zhang L, Chen S, Deng L, Qian Y, Wang L, Huang W 2015 AIP Adv. 5 067121
- [14] Deng L, Zhou Z, Jia B, Zhou H, Peng L, Shang W, Feng J, Chen S 2018 Org. Electron. 53 346
- [15] Kim T, Kang S, Heo J, Cho S, Kim J W, Choe A, Walker B, Shanker R, Ko H, Kim J Y 2019 Adv. Mater. 30 1800659
- [16] Chen P, Xiong Z, Wu X, Shao M, Meng Y, Xiong Z H, Guo C 2017 J. Phys. Chem. Lett. 8 3961
- [17] Shi Z, Li Y, Li S, Li X, Wu D, Xu T, Tian Y, Chen Y, Zhang Y, Zhang B, Shan C, Du G 2018 Adv. Funct. Mater. 28 1707031
- [18] Cho C, Kang H, Baek S, Kim T, Lee C 2016 ACS Appl. Mater. Interfaces 8 911
- [19] Jia B L, Deng L L, Chen R X, Zhang Y N, Fang X M 2017 Acta Phys. Sin. 66 237801 (in Chinese) [贾博仑, 邓玲玲, 陈若曦, 张雅男, 房旭民 2017 物理学报 66 237801]
- [20] Siekkinen A, Mclellan J, Chen J, Xia Y 2006 Chem. Phys. Lett. 432 491
- [21] Deng L, Yang J, Zhan N, Yu T, Yu H, Chen S 2019 Opt. Lett. 44 983
- [22] Kim T, Kang H, Jeong S, Kang D J, Lee C, Lee C H, Seo M K, Lee J Y, Kim B J 2014 ACS Appl. Mater. Interfaces 6 16956

Efficiency improvement in solution-processed multilayered phosphorescent white organic light emitting diodes by silica coated silver nanocubes^{*}

Zhang Ya-Nan¹⁾ Zhan Nan²⁾ Deng Ling-Ling²⁾ Chen Shu-Fen^{3)†}

1) (School of Physics and Optoelectronic Engineering, Nanjing University of Information Science

and Technology, Nanjing 210044, China)

2) (College of Electronic and Optical Engineering & College of Microelectronics, Nanjing

University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, China)

3) (Key Laboratory of Organic Electronics and Information Displays, College of Materials Science and Engineers,

Nanjing University of Posts & Telecommunications, Nanjing 210023, China)

(Received 9 October 2019; revised manuscript received 16 December 2019)

Abstract

Localized surface plasmon resonance (LSPR) effect of metal nanoparticles (MNs) has been widely applied in organic light-emitting diodes (OLEDs) to improve the radiation of excitons. The LSPR wavelength and intensity of MNs and the coupling between MNs and excitons greatly affect the LSPR effect on exciton radiation. In this work, silica coated silver nanocubes (Ag@SiO₂ NCs) were doped in the electron transport layer (ETL) of a solution-processed multilayered white OLED (WOLED). Due to the sharp edges and corners, Ag NCs have strong LSPR effect and can effectively enhance the radiation of nearby excitons. With an appropriate concentration of Ag@SiO₂ NCs, the WOLED achieved two fold improvement in the current efficiency comparing with the control device without Ag@SiO₂ NCs incorporated. The working mechanism of the Ag@SiO₂ NCs based WOLED was investigated in detail. For the solution-processed OLED, excitons usually form and recombine near the interface of emission layer and electron transport layer (EML/ETL) because the commonly used host material (such as polyvinylcarbazole, PVK) has the unipolar hole transport property. So the Ag@SiO₂ NCs in ETL greatly enhanced the radiation of the excitons located near the EML/ETL interface, which mostly contributed to the performance enhancement of the $Ag@SiO_2$ NCs based WOLED. Study on a group of devices with Ag@SiO₂ NCs doped in different locations indicated that Ag@SiO₂ NCs in ETL showed more effective LSPR effect than those in hole injection layer. Electroluminescence and photoluminescence spectra of the WOLEDs declared that the $Ag@SiO_2$ NCs simultaneously improved the radiation intensities of the blue and yellow excitons and helped the WOLED maintain the good chromaticity stability, which was mainly attributed to the wide LSPR wavelength range (450-650 nm) of the Ag@SiO₂ NCs. The SiO₂ coating layer of the $Ag@SiO_2$ NCs played the important role in the LSPR enhanced emission. On the one hand, it formed an appropriated distance between the Ag NCs and the extions, helping to generate the strong coupling

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No. 2015CB932203), the National Key Research and Development Program of China (Grant No. 2017YFB0404501), the National Major Fundamental Research Program of China (Grant No. 91833306), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 61505086, 61575096, 61705111), the Science Fund for Distinguished Young Scholars of Jiangsu Province, China (Grant No. BK20160039), the Natural Science Foundation of Jiangsu Province, China (Grant No. BM2012010), the Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions, China (Grant No. YX030002), and the National Postdoctoral Program for Innovative Talents, China (Grant No. BX201700122).

[†] Corresponding author. E-mail: iamsfchen@njupt.edu.cn

between them. On the other hand, it suppressed the effect of Ag NCs on charge trapping, keeping the stability of the carrier transport in the device. Our research demonstrate MNs can effectively improve the performance of OLEDs by carefully designing the device structure.

Keywords: white organic light-emitting diodes, Ag nanocubes, localized surface plasmon resonance, solutionprocessed electron transporting layer

PACS: 78.20.Bh, 78.40.Kc, 78.67.Bf

DOI: 10.7498/aps.69.20191526